

期刊信息

篇名	室温低压下脉冲等离子体生长立方氮化硼薄膜
语种	中文
撰写或编译	撰写
作者	闫鹏勋,杨思泽
第一作者单位	中国科学院物理研究所
刊物名称	金属学报
页面	1995,31,439
出版日期	1995年 4月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	高能量密度等离子体法制备立方氮化硼薄膜